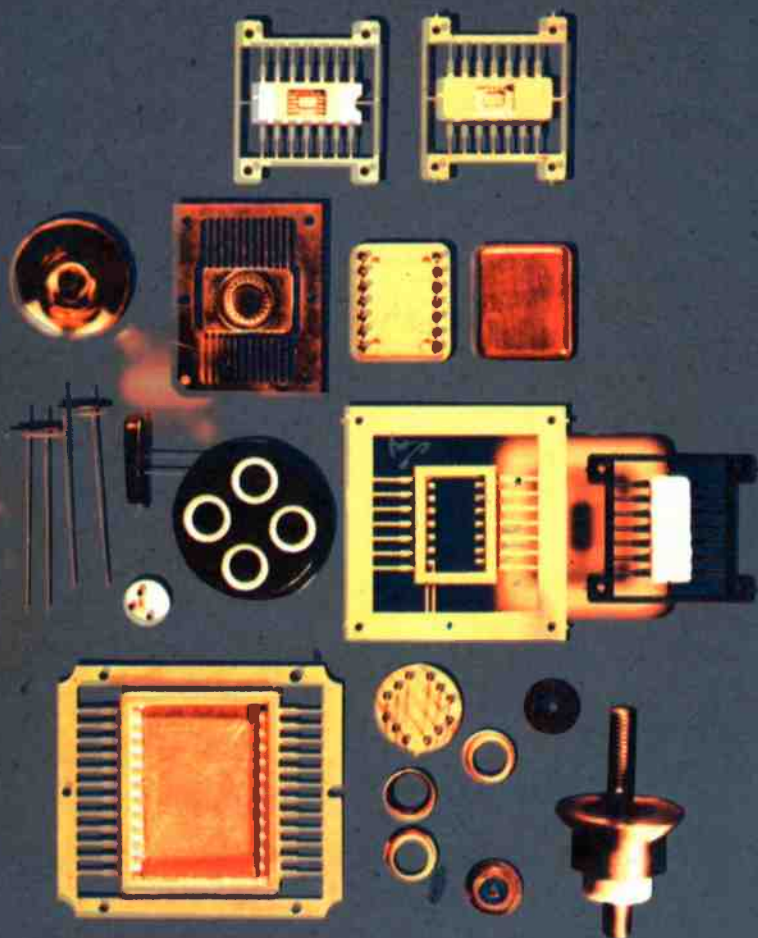


Nr 2 (26)
1979

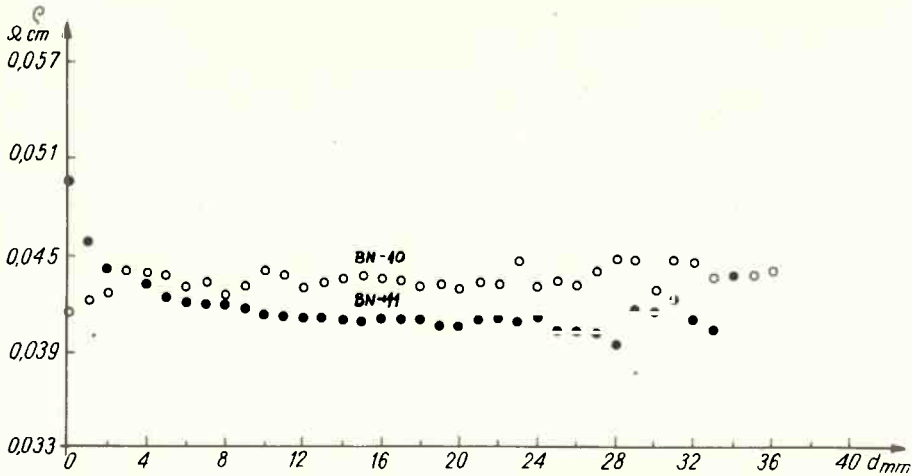
MATERIAŁY ELEKTRONICZNE



Uzupełnienie

dotyczące rys. 2, str. 39, zamieszczonego w "Materiałach Elektronicznych" nr 1/25/1979

1. Na rys. 2 powinny być oznaczone typy ceramik: BN-10 i BN-11.



2. Podpis pod rysunkiem powinien być następujący:

Oporność powierzchniowa płytek krzemu z wdyfundowanym borem z BN-10 i BN-11, mierzona wzdłuż średnicy równoległej do ścienia bazowego płytek

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE
MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH
WARSZAWA

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

Nr 2 (26) – 1979



WYDAWNICTWA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO „WEMA”
Warszawa 1980

<http://rcin.org.pl>

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny: Bolesław JAKOWLEW
Z-ca Redaktora Naczelnego: Paweł DRZEWIECKI

REDAKTORZY DZIAŁOWI

Jan BEKISZ
Bohdan CISZEWSKI
Zenon HORUBAŁA
Andrzej HRUBAN
Czesław JAWORSKI
Edward SZABELSKI
Andrzej TACZANOWSKI
Władysław WŁOSIŃSKI

Sekretarz Redakcji: Wiesława DZIUBIŃSKA

ADRES REDAKCJI

ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa
tel. 43-74-61 i 43-54-24

SPIS TREŚCI

Analiza defektów występujących w strukturze krzemu na podstawie obserwacji taśm krzemowych otrzymanych metodą EFG (cz. II) – B. CISZEWSKI, J. KAŹCKI	7
Oznaczenie trójchlorosilanu w czterochlorku krzemu metodami ebuliometryczną i densymetryczną – J. RADOMSKI, W. M. REČKO	16
Wpływ obróbki elektrod na efekt rozpraszania dynamicznego mieszaniny azoksyzwiązków – T. SIWIEC, E. NOWINOWSKI-KRUSZELNICKI, J. ZIELIŃSKI, J. ŻMIJA	24

CONTENTS

An analysis of the defects occurring in silicon structure on the base of EFG silicon ribbon observation (part II) – B. CISZEWSKI, J. KAŹCKI	7
A determination of trichlorosilane in silicium tetrachloride by ebullioscopic and densimetric methods – J. RADOMSKI, W. M. REČKO	16
An influence of electrode treatment on dynamic scattering effect of azoxy compounds mixture – T. SIWIEC, E. NOWINOWSKI-KRUSZELNICKI, J. ZIELIŃSKI, J. ŻMIJA	24

СОДЕРЖАНИЕ

Анализ дефектов, встречаемых в структуре кремния, на основании наблюдений кремниевых лент получаемых методом EFG (часть II) – Б. ЦИШЕВСКИ, Е. КОНТЦКИ	7
Определение трихлоросилана в хлористом кремнии эбулиометрическим и денсиметрическим методами – Я. РАДОМСКИ, В. М. РЕТЬКО	16
Влияние обработки электродов на эффект динамического рассеяния смеси азоксисоединений – Т. СИВЕЦ, Э. НОВИНОВСКИ-КРУШЕЛЬНИЦКИ, Е. ЗЕЛИНЬСКИ, Ю. ЖМИЯ	24

B. CISZEWSKI, J. KĄTCKI: Analiza defektów występujących w strukturze krzemu na podstawie obserwacji taśm krzemowych otrzymanych metodą EFG (część II)

Na podstawie obserwacji struktury i morfologii taśm krzemowych otrzymanych metodą EFG przedstawiono podstawowe defekty struktury występujące w kryształach krzemu.

J. RADOMSKI, W. M. REĆKO: Oznaczanie trójchlorosilanu w czterochlorku krzemu metodami ebuliometryczną i densymetryczną

W artykule przedstawiono zastosowanie metod ebuliometrycznej i densymetrycznej do oznaczania trójchlorosilanu w czterochlorku krzemu.

T. SIWIEC, E. NOWINOWSKI-KRUSZELNICKI, J. ZIELIŃSKI, J. ŻMIJA: Wpływ obróbki elektrod na efekt rozpraszania dynamicznego mieszanin azoksywiazków

W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu sposobu obróbki powierzchni elektrod na statyczne i dynamiczne charakterystyki elektrooptyczne efektu rozpraszania dynamicznego w ciekłych kryształach z grupy azoksywiazków. Zbadano wpływ mycia w różnych rozpuszczalnikach organicznych, trawienia jonowego oraz prostopadłego napylania warstwy SiO_x. Na podstawie uzyskanych wyników optymalnym sposobem przygotowania elektrod okazało się trawienie jonowe, które wyraźnie poprawiło parametry uporządkowania ciekłego kryształu.

Б. ЦИШЕВСКИ, Е. КОНТЦКИ: Анализ дефектов, встречаемых в структуре кремния, на основании наблюдений кремниевых лент, получаемых методом EFG (часть II)

На базе наблюдений структуры и морфологии кремниевых лент представлены основные дефекты структуры, встречаемые в кристаллах кремния.

Я. РАДОМСКИ, В. М. РЭТЬКО.: Определение трихлоросилана в хлористом кремнии збулиометрическим и денсиметрическим методами

В статье представлено применение методов: збулиометрического и денсиметрического к определению трихлоросилана в хлористом кремнии.

Т. СИВЕЦ, Э. НОВИНОВСКИ-КРУШЕЛЬНИЦКИ, Е. ЗЕЛИНСКИ, Ю. ЖМИЯ: Влияние обработки электродов на эффект динамического рассеяния смеси азоксисоединений

В работе представляются результаты исследований электродов, оптических свойств смесей Ж. К. из группы азоксисоединений. Изучается влияние на электрооптические характеристики эффекта динамического рассеяния.

B. CISZEWSKI, J. KĄTCKI: An analysis of the defects occurring in the silicon structure on the base of EFG silicon ribbon observation (part II)

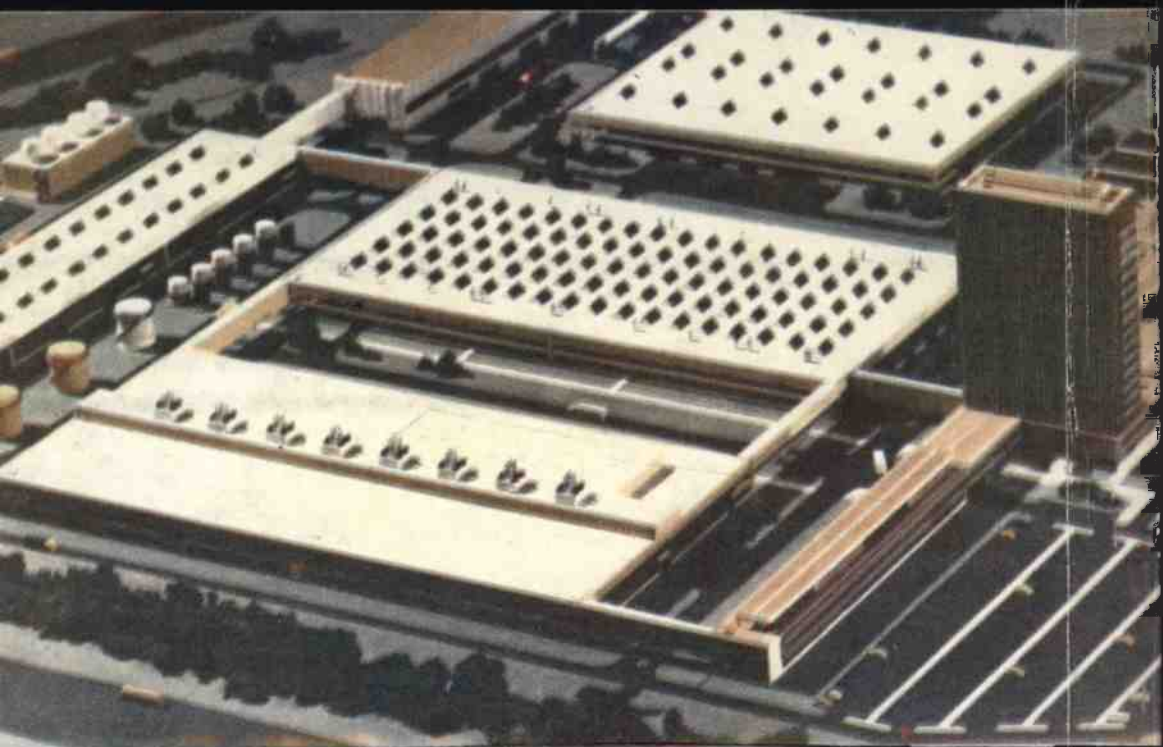
Using structure and morphology observations of EFG silicon ribbons the main structure defects of silicon crystals are discussed.

J. RADOMSKI, W. M. RECKO: A determination of trichlorosilane in silicium tetrachloride by ebullioscopic and densimetric methods

Application of thermodynamic methods to the determination of trichlorosilane in silicium tetrachloride is described.

T. SIWIEC, E. NOWINOWSKI-KRUSZELNICKI, J. ZIELIŃSKI, J. ŻMIJA: An influence of electrode treatment on dynamic scattering effect of azoxy compounds mixture

The paper presents the results of investigation DSE in azoxy compounds mixtures. The transmission voltage characteristics in unpolarized and polarized light were measured. Optical response rise and decay time for different methods of surface preparation like washing in organic compounds, chemical and physical treatment are given.



CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE
MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH
ul. Konstruktorska 6, 02-673 WARSZAWA